

環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程 実施

キャリアアップMOTプログラム

CUMOT

- 働きながらMOT(技術経営)を学び、キャリアに活かす -



Zoomによるオンライン講義形式は全国から参加が可能

## ご挨拶

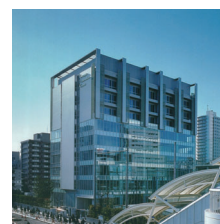
MOT(Management of Technology: 技術経営)とは、技術を創造しそれを知的財産として活用し事業化するというイノベーション創出サイクルのマネジメントです。先行きが不透明な中で未来を切り拓いていくため、産業・企業にとっては既存ビジネスの再構築や新ビジネスの創造が大きな課題となっており、イノベーションを創出する技術経営(MOT)がますます重要になっています。キャリアアップMOTは、次世代の企業経営を担う人材がMOTのマネジメントのエッセンスを学び、キャリアアップを図ることを目的としています。

東京科学大学 環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程において、現在、技術経営を学んでいる学生の多くは社会人学生です。そこには様々な分野、企業・団体から修士、博士学生がMOTを学び、学びを通じた修了生を含めた新しいネットワークが生まれています。本プログラムも同様に、多くの方々がMOTを修得することによってキャリアアップを実現されるとともに、その学びを通じた交流で人的ネットワークを構築し、イノベーションを創出する場となることを期待しています。

東京科学大学 環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程

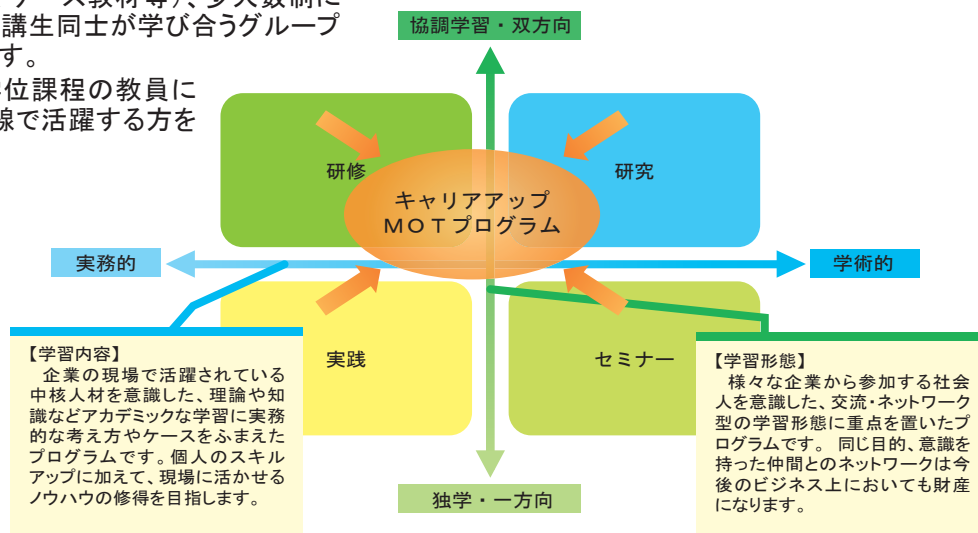
## CUMOTとは？

- 社会人アカデミーのプログラムとして、環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程が実施するMOT(技術経営)に関するサーティフィケート・プログラムです。
- 平日夜、週1回の通学など、社会人の方が働きながらMOTの学びを通じて、キャリア形成を図ることを支援する取り組みです。多様な業界・業種から、経営者、マネージャー、若手など多くの社会人が受講しています。
- Zoomを用いたオンライン講義形式の場合、通信環境があれば全国から受講いただくことが可能です。
- 対面講義形式の場合、受講場所は田町キャンパス(JR田町駅徒歩1分)です。



## プログラムの位置づけ

- 次世代の企業経営を担う人材など、産業界で活躍する人々が必要とする大学院レベルのMOTに関するコースを提供します。
- 技術経営専門職学位課程のMOT教育のノウハウを活かし、現場・実践を意識したカリキュラム(実務経験を有する講師陣、シミュレーション教材、ケース教材等)、少人数制による質の高い講義を提供し、受講生同士が学び合うグループ課題にも取り組んでいただきます。
- 講師陣は、技術経営専門職学位課程の教員に加え、外部から各分野の最前線で活躍する方を講師として招聘しています。



## 実施体制・プログラム修了の認定

主催：東京科学大学社会人アカデミー 実施主体：環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程  
修了認定：修了者には社会人アカデミー長名の「修了証書」を交付いたします。評価については、出席状況を含め、コースごとに行います。

# キャリアアップMOT (CUMOT)

## コース紹介

平日夜を中心にMOTに関連する各コースを開催しています。1回2時間または1日単位の構成です。学習形態は、Zoomによるオンライン講義形式または対面の講義形式(田町キャンパス、JR田町駅徒歩1分)です。

名称・回数	受講対象者	概要	開催期間 / 日時
エッセシャルMOT (全36回)	次世代の企業経営を担う社会人の方 (例)若手後継者、技術系管理職、幹部候補生、経営企画職、ベンチャー企業経営者、等	「イノベーション論」「企業戦略とイノベーション」など、MOTのエッセンス(11科目)を1年間に渡って学びます。	4月～翌年2月 水曜 19時～21時
エッセシャルMOT 秋季(全24回)		「エッセシャルMOT」のカリキュラムをベースに、半年間で学ぶことができるコースです。	10月～翌年3月 水曜 19時～21時
エッセシャルMOT 夏季集中(全20回)		「エッセシャルMOT」のカリキュラムをベースに、4か月間で学ぶことができるコースです。	6月～9月 火曜 19時～21時、土曜日中
知的財産戦略 (全12回)	・知的財産の戦略的マネジメントの習得を目指す方 (例)企業の知的財産部および特許事務所、研究開発部門・技術企画部門における技術者・研究者等 ・現業とリンクした知的財産戦略の習得を目指す方 (例)公認会計士・ベンチャーキャピタリスト・コンサルタント等	知的財産と経営との関係性を理解しつつ、企業等の競争力強化に貢献できる知的財産戦略をデザインし、マネジメントできる力を養うことを目指すコースです。	5月～8月 水曜 19時～21時
サービスイノベーション集中 (全10回)	次世代の企業経営を担う人材、組織・個人にとって価値のある新たなサービス(無形財)を創出することが求められる人材	「サービスイノベーション論」「プロダクト・サービスデザイン」「サービスデザイン」「サービス工学」など、サービスイノベーションの実現に必要なエッセンスを短期間で集中的に学びます。	10～11月頃開催予定 (土曜、5日間)
CUMOT×STAMP 連携プログラム (全10回)	・次世代の企業経営や組織マネジメントを担う人材 ・企業経営の経験者から直接、話を聞いたり、議論をしたい方 ・組織のメンバーとして経営者の考え方や意思決定の方法、リーダーシップなどについて学びたい方 など	技術経営士の会 (STAMP) のメンバーが持つ豊富な企業経営の経験をもとに、事例研究に取り組むコースです。	11月～翌年2月 木曜 19時～21時
標準化戦略実践コース(全12回)	・ビジネスのグローバル展開やオープンイノベーションのため、実践的な標準化戦略を習得したい方 ・企業の標準化部門・事業開発部門等で、業務とリンクした国際標準化戦略の習得を目指す方	グローバル市場を開拓・リードするための重要な戦略ツールである国際標準化について、実践的な標準化戦略(ビジネス戦略、標準活用など)を学びます。	6～9月、火曜 16時30分～17時30分 ※別途1時間の講義録画を事前視聴
サイバーセキュリティ経営戦略(全18回)	サイバーセキュリティ経営の企画、現場の情報システム/セキュリティ担当からのステップアップ、事業部門へのサイバーセキュリティ経営に取り組む方、など。	サイバーセキュリティ経営及びその戦略立案に求められる知識・能力を備え、企業・組織を先導する人材の育成を目的とします。	11月～翌年3月 木曜 19時～21時

※2024年3月現在の予定で、一部、変更になる場合があります

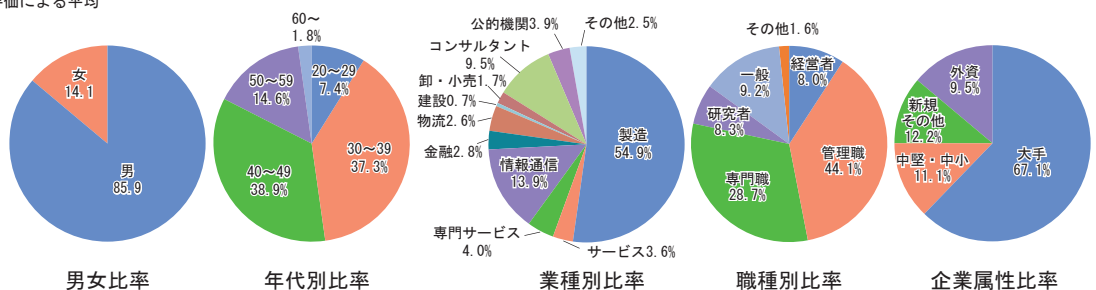
## 受講実績

### 受講アンケートによる評価(例)

※5段階評価による平均

- ・満足度
  - エッセシャルMOT 4.2
  - 知的財産戦略 4.7
  - サービスイノベーション 4.1
- ・業務への役立度
  - エッセシャルMOT 4.3
  - 知的財産戦略 4.5
  - サービスイノベーション 4.3

### 受講者属性



※受講者1,844名(2024年3月現在)の願書等に基づいて集計

### 受講された方の声

- ・自らがイノベーションを考えなければならないということを肌身で感じられた(エッセシャルMOT)
- ・色々な背景を持つ方と一緒に学ぶ機会は貴重でした。また、様々なバックグラウンドの先生から学ぶことが出来たのは、本当に良かったです(エッセシャルMOT)
- ・回数を重ねるにつれて講義が面白くなってきました。東京工業大学ならではの先進的なマネジメントの知識を習得することができました(エッセシャルMOT秋季)
- ・単一科目の内容についての知識を得たり理解を深めるのみならず、技術経営全体としてそれぞれの講義内容の関係性を意識しながら学ぶことができた(エッセシャルMOT夏季)
- ・サービスの無形のものでイノベーションを起こし、価値を生み出すための気づきが得られた(サービスイノベーション集中)
- ・企業において、日本において、知的財産の創造、保護活用が重要であること、各部署、各機関との連携が大切であることの理解を深めました。また、学ぶことの楽しさ、大切さに気付かされました。今後も学びの継続とアウトプットをしていきたいです(知的財産戦略)
- ・実体験を伴う講師の方々のお話は常にスケールが大きく、見渡すべき視野の広さや時間の尺度など様々な点において、これまでの自分の見方や考え方は限定的であったと感じるようになった(CUMOT×STAMP連携プログラム)
- ・自社の標準化戦略を考えていくにあたり、「世界全体を俯瞰した全体論」と「過去の事例による具体論」を両面から学ぶことができ、有益であった(標準化戦略実践)
- ・DXやデータドリブン経営が叫ばれる中、ITへの依存度が飛躍的にあがることで、サイバーセキュリティに対する企業の姿勢が経営課題に直結することが理解できた(サイバーセキュリティ経営戦略)

## CUMOT 担当教員メッセージ

古侯升雄 特任教授 専門分野：リカレント教育、キャリアデザイン、協調学習  
多様な社会人の方々が働きながらMOTを学び、自らのキャリア形成に活用しています。「教わる」ではなく自ら「学ぶ」という意識をお持ちの方を歓迎します。

## お問い合わせ

メール：cumot-info@mot.titech.ac.jp

詳細・最新情報は、下記のURLをご参照ください。

<https://www.cumot.isc.ens.titech.ac.jp/>